【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公開番号】特開2005-85339(P2005-85339A)
【公開日】平成17年3月31日(2005.3.31)
【年通号数】公開・登録公報2005-013
【出願番号】特願2003-314542(P2003-314542)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ１１Ｂ　5/73
　Ｇ１１Ｂ　5/84
【ＦＩ】
　Ｇ１１Ｂ　5/73
　Ｇ１１Ｂ　5/84　　Ａ
　Ｇ１１Ｂ　5/84　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成17年6月21日(2005.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも片面がベース面とされた主基板にバイアスパワーを印加しつつ前記ベース面上に非磁性材料を成膜して副基板を形成し、表面粗さが前記主基板のベース面の表面粗さよりも小さい磁気記録媒体用基板を得ることを特徴とする磁気記録媒体用基板の製造方法。
【請求項２】
　少なくとも片面がベース面とされた主基板の前記ベース面上に非磁性材料を成膜して副基板を形成し、該副基板の表面をドライエッチングで加工して、表面粗さが前記主基板のベース面の表面粗さよりも小さい磁気記録媒体用基板を得ることを特徴とする磁気記録媒体用基板の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記副基板の材料として、二酸化ケイ素、ケイ素、ダイヤモンドライクカーボン、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化クロム、炭化物、窒化物、ＩＴＯのいずれかを含む材料を用いることを特徴とする磁気記録媒体用基板の製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記主基板の材料として、ガラス、アルミナ、ケイ素、グラシーカーボン及び樹脂のいずれかを含む材料を用いることを特徴とする磁気記録媒体用基板の製造方法。
【請求項５】
　少なくとも片面がベース面とされた基板の前記ベース面をドライエッチングを用いて平坦化することを特徴とする磁気記録媒体用基板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかにおいて、
　中心線平均粗さが１ｎｍ以下となるように表面を仕上げるようにしたことを特徴とする磁気記録媒体用基板の製造方法。

【請求項７】
請求項１乃至６のいずれかに記載の磁気記録媒体用基板の製造方法により製造した磁気記録媒体用基板上に、直接的又は間接的に記録層を形成することを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。